

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第3部門第1区分
 【発行日】平成20年7月24日(2008.7.24)

【公開番号】特開2007-1787(P2007-1787A)
 【公開日】平成19年1月11日(2007.1.11)
 【年通号数】公開・登録公報2007-001
 【出願番号】特願2005-180990(P2005-180990)
 【国際特許分類】

C 3 0 B 29/16 (2006.01)

H 0 1 L 21/465 (2006.01)

C 3 0 B 33/02 (2006.01)

C 3 0 B 33/10 (2006.01)

【F I】

C 3 0 B 29/16

H 0 1 L 21/465

C 3 0 B 33/02

C 3 0 B 33/10

【手続補正書】

【提出日】平成20年6月9日(2008.6.9)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項3

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項3】

前記工程 b で用いられるエッチング液が、エチレンジアミン四酢酸二水素二ナトリウムとエチレンジアミンとの混合液を含む請求項1または2に記載のZnO基板の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0023

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0023】

ZnO膜を発光素子として用いる場合には、Li濃度を $1 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 以下にすることが好ましい。この要請を満たすために、ZnO膜の成長温度が700の場合、ZnO基板中のLi濃度を $4 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$ 以下にしておくことが好ましい。